PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-174896

(43)Date of publication of application: 14.07.1995

(51)Int.CI.

G21K GO2B

GO3F

GO3F

G21K 5/02

H01L 21/027

(21)Application number: 05-319725

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

20.12.1993

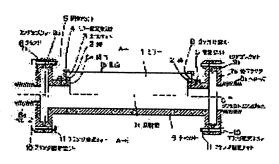
(72)Inventor: HARUMI KAZUYUKI

WATANABE YUTAKA

(54) MIRROR UNIT AND EXPOSING DEVICE WITH THE UNIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a small mirror unit having good cooling efficiency of a mirror, easy to exchange the mirror, and excellent in the maintenance property. CONSTITUTION: A mirror 1 is installed at the opening 6a of a chamber 6 so that the reflecting surface 1a side faces the inside of the chamber 6. A frame 2 is fixed at the convex shoulder portion of the mirror 1 having a convex cross section. The frame 2 is formed into a plate shape having an opening through which the convex section of the mirror 1 can pass at the center, and an edge for pressing a gasket 3 is circularly formed on the opposite face to the fixed face to the mirror 1. A similar edge is circularly formed at the opposite position to the edge of the frame 2, and the gasket 3 is sandwiched by



both edges formed on the chamber 6 and the frame 2. A mirror fixing member 4 is fastened to the chamber 6 to fix the mirror 1 to the chamber 6 and to press the gasket 3 sufficiently for vacuum sealing.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3311126

[Date of registration]

24.05.2002

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-174896

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
G21K	1/06	N						
G02B	5/08	F						
G03F	7/20	503				•		
	•	5 2 1					•	
		•	7352-4M	HO1L	21/ 30		531 A	
			審査請求	未請求,請求項				最終頁に続く
(21)出願番号		特願平5-319725		(71)出願人	000001	007		
					キヤノ	ン株式	会社	
(22)出顧日		平成5年(1993)12)		東京都	大田区	下丸子3丁目3	0番2号	
				(72)発明者				
-					東京都	大田区	下丸子3丁目3	0番2号 キヤ
		•			ノン株			
				(72)発明者				
					東京都	大田区	下丸子3丁目3	0番2号 キヤ
					ノン株			
				(74)代理人	弁理士	若林	忠	
								•

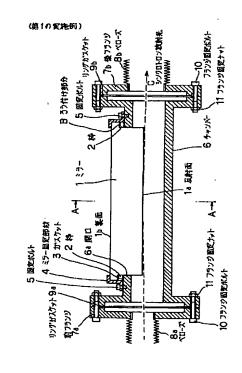
(54) 【発明の名称】 ミラーユニットおよび眩ミラーユニットを備えた露光装置

(57)【要約】

【構成】

【目的】 ミラーの冷却効率が良く、ミラーの交換が容易で、しかもメンテナンス性に優れた小型なミラーユニットを提供する。

【構成】 チャンバー6の開口6 a に、反射面1 a 側をチャンバー6の内部になるようにミラー1が設置される。断面凸形状のミラー1の凸の肩部分に、枠2が固着されている。枠2は、中央にミラー1の凸部が通ることが可能な開口を有する板形状をしており、ミラー1との固着面との反対面には、ガスケット3を押えるためのエッジが環状に形成されている。チャンバー6には、枠2のエッジの対向位置に該エッジと同様のエッジが環状に形成されたエッジによって、ガスケット3を挟み込む。ミラー1をチャンバー6に固定するため、及びガスケット3を真空封止に十分なだけ押えるために、ミラー固定部材4をチャンバー6に締結する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空チャンバー内に、ミラーの反射面が 設置されるミラーユニットにおいて、

ミラーもしくはミラーを保持するミラー保持部材が、ミ ラーの反射面を真空チャンパー内に向けて、真空チャン バーに設けられた開口に取り付けられていることによ り、ミラーもしくはミラー保持部材が真空チャンバーの 真空隔壁の一部を形成し、また、真空チャンバーと、ミ ラーもしくはミラー保持部材との間が真空シール構造と なっていることを特徴とするミラーユニット。

【請求項2】 請求項1に記載のミラーユニットが、光 源と露光装置本体との間の光路途中に設置されている、 露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路の製造 等で使用される露光装置において、波長の短いX線等を 利用するために用いられるミラーユニット(反射鏡ユニ ット)、および該ミラーユニットを備えた露光装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】照明光源としてX線を、マスクのバター ンを近接したウエハの上のレジストに露光させるX線露 光装置において、シンクロトロン放射光をX線源として 利用したものが提案されている。

【0003】シンクロトロン放射光は、電子の軌道面に 光を発散させるSOR装置から得られる。SOR装置の 光は、電子軌道面に平行な方向には大きな広がりを持つ が、電子軌道面に垂直な方向はせいぜい数mrad程度 の発散角の広がりしかない。このため、露光装置として 必要な数cmの露光領域を確保するためには、シンクロ トロン放射光を垂直方向に拡大する必要がある。その方 法として、平面ミラーを、放射光の方向と垂直で電子軌 道面と平行な方向を軸として揺動させる方法や、凸面ミ ラーによって反射光を垂直方向に拡大する方法が提案さ れている。

【0004】凸面ミラーによって露光領域を確保する方 式のミラー支持装置の従来例としては、例えば本出願人 による特開平5-100096号公報に開示されたもの がある。

【0005】図13は従来例の露光装置の一部を破断し た概略斜視図、図14は図13における、ミラーユニッ トの拡大断面図である。

【0006】図13および図14に示すように、真空チ ャンバー100内には、ミラー保持器102を介してミ ラー101が取り付けられた支持板103が設けられ、 ミラー101の全体が真空チャンバー100内に設けら れている。この支持板103は、貫通孔114を有し、 内部フランジ111、および排気口109を有する支持

持体107に支持されている。また、内部フランジ11 1はベローズ105を介して真空チャンバー100に支 持され、ミラー保持器102は内部ベローズ110を介 して内部フランジ111に支持されている。 ミラー支持 体107は駆動モーター117により駆動されて位置出 しが行われ、また、基準フレーム115に設けられたチ ルト板116によってその傾きが調整される。なお、符 号118はミラー支持体107を案内するためのガイド を示し、符号119a,119bは前記傾きを微調整す 10 るための調整ねじを示している。支持棒106内にはミ ラー冷却用配管108が挿入され、このミラー冷却用配 管108は、ミラー保持器102に形成された冷却流路 (冷却水路)112に通じている。符号113は、ミラ 一冷却用配管 108 および冷却流路 112 の接続部をシ ールするためのOリングである。

【0007】ミラー101は、シンクロトロン放射光の 減衰を避けるため、真空中に設置される。また、ミラー 101に入射した光のうち、長波長の光は反射するが、 短波長の光は、ミラー101に吸収され、そのエネルギ 20 一が熱に変換される。その熱によりミラー101の温度 が上昇し、反射面形状が熱膨張により変形すると、露光 のむらを生じる原因となるため、熱を外部に逃がすため の、ミラー冷却用配管108や冷却流路112等の冷却 手段がミラー101に付随した構成となっている。冷却 水が、真空中に漏れることのないように冷却流路112 は、二重にシールされている。ミラー101の冷却は、 冷却流路112のあるミラー保持器102を冷却すると とによってミラー101を間接的に冷却することにより 行われる。ミラー保持器102とミラー101との界面 は真空中にあるため、接触熱抵抗が生じる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来技 術のものでは、以下に記述するような問題点がある。す なわち、真空チャンバー内に設置されているミラーを冷 却するために、冷却水を循環させるための冷却流路(冷 却水路)を設けたミラー保持器に、冷却水配管(ミラー 冷却用配管)を真空チャンパー内に導入する必要があ る。ミラーの交換は、ミラーの位置出しを容易にするた め、ミラーの取り付いたミラー保持器ごと行なうため、 ミラーの交換の度にミラー冷却用配管の接続を、作業性 の悪いミラーチャンパー内で行う必要があり、ミラー交 換の作業性が著しく悪い。

【0009】また、真空チャンバー内に冷却水が漏水す ることは、真空チャンバーの真空度を著しく低下させる ことになるため、冷却水の漏れることのないように十分 な対策を施す必要から真空チャンバーの構成が複雑にな り、メンテナンス性を損なっているとともに、コストが 増加する。

【0010】さらに、真空チャンパー内に、ミラーと冷 棒106を介して、真空チャンバー100外のミラー支 50 却部材(ミラー保持器)との間に界面があり、接触熱抵 3

抗により冷却効率が損なわれていたため、冷却効率を向上させる余地が残っている。

【0011】本発明は、上記従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、ミラーの冷却効率が良く、ミラーの交換が容易で、しかもメンテナンス性に優れた小型なミラーユニットおよび、該ミラーユニットを備えた露光装置を提供することを目的としている。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための本発明は、真空チャンバー内に、ミラーの反射面が設 10 置されるミラーユニットにおいて、ミラーもしくはミラーを保持するミラー保持部材が、ミラーの反射面を真空チャンバー内に向けて、真空チャンバーに設けられた開口に取り付けられていることにより、ミラーもしくはミラー保持部材が真空チャンバーと、ミラーもしくはミラー保持部材との間が真空シール構造となっていることを特徴とするものである。

【0013】また、本発明の露光装置は、本発明のミラーユニットが、光源と露光装置本体との間の光路途中に 20設置されている。

[0014]

【作用】上記のとおりに構成された本発明では、ミラーの反射面のみ真空内に入れ、その裏面あるいはミラー保持部材を大気中に露出した構成とすることにより、ミラーの反射面で吸収された熱が、真空中の界面を経ずに大気側に伝わり、冷却されるので、ミラーの冷却効率がよくなる。また、従来のようなミラーの交換の度に行う、作業性の悪いミラーチャンバー内でのミラー冷却用配管の接続がなくなり、従来のフランジ取付けと同様なミラーの交換を行え、ミラーの交換が容易になる。さらに、従来のような冷却水の漏れがないような対策が不要であるので、真空チャンバーの構成が簡単になり、メンテナンス性が向上する。

【0015】また、本発明のミラーユニットを有する露 光装置の照明系の露光光学系に適用することにより、低 コストで半導体デバイスを生産できる。

[0016]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

【0017】(第1の実施例)図1は本発明の反射鏡ユニットの第1の実施例の縦断面図、図2は図1のA-A線断面図である。

【0018】図1に示すように、本実施例は、シンクロトロン放射光を利用した半導体露光装置において、光源であるシンクロトロンリングと露光装置との間のシンクロトロン放射光Cの光路途中に設置されて、円筒状の反射面によりシート状の破線矢印で示すシンクロトロン放射光Cを垂直方向に拡大するための、反射鏡としてのミラー1を支持するミラーユニット(ミラーチャンバー)

である。シンクロトロン放射光Cの光路であるチャンバー (ビームラインとも言う)の内部は、真空となっている。なお、図1はミラーチャンバーの、シンクロトロン放射光Cの光軸に沿った断面図である。

【0019】図1及び図2に示すように、チャンバー6は、前方を前フランジ7aおよびベローズ8aを介して、光源であるシンクロトロンリング(不図示)に結合されるている。このチャンバー6の後方は、後フランジ7aおよびベローズ8bを介してビームラインの後方すなわち露光装置本体(不図示)へつながり、照明光を露光装置本体(不図示)へ導く。それぞれ、チャンバー6と前後のフランジ7a,7bは、真空シールのためのリングガスケット9a,9bを間に挟んで複数本のフランジ固定ボルト10及びフランジ固定ナット11によって固定されており、この構成によりチャンバー6内は超高真空もしくは高真空状態に保たれている。

【0020】チャンバー6には、ミラー1を取付けるた めの開口6aが形成され、開口6a内にミラー1の反射 面1aをチャンパー6の内部になるように(図1では下 向き) ミラー1が設置される。ミラー1の裏面1 b は外 界(大気中)に露出している。ミラー1は、シート状の シンクロトロン放射光Cを垂直方向に拡大するために、 反射面1aが半径100m程度の円筒状をしており、円 筒の円周方向がシンクロトロン放射光Cの光軸と平行に 入射角10mrad程度で設置される。ミラー1の断面 は凸になっており、該凸の肩の部分に枠2が、気密に保 つことが可能な方法、例えばろう付けで固着されている (ろう付け部分B参照)。また、枠2は、中央にミラー 1の凸部が通ることが可能な開口を有する板状の形をし ており、ミラー1との固着面との反対面には、真空封止 用のガスケット3を押えるためのエッジ (突起) が環状 に形成されている。また、チャンバー6には、枠2のエ ッジの対向位置に枠2のエッジと同様のエッジ (突起) が環状に形成されている。チャンバー6と枠2の両方に 形成されたエッジによって、ガスケット3を挟み込むと とによって、真空の封止を可能としている。 ミラー1を チャンバー6に固定する目的と、ガスケット3を真空封 止に十分なだけ押えるために、枠形状のミラー保持部材 としてのミラー固定部材4を複数本のボルト5によって 40 チャンバー6に締結する。ミラー固定部材4は、ミラー 1に片寄った力が働いてミラー1の反射面1aを変形さ せることのないように、比較的柔軟なブラスチックのよ うな枠形状の素材によってつくられている。

【0021】上記構成のミラーユニットは、シンクロトロンリングと露光装置の間のビームライン中に設置され、放射光をミラー1で垂直方向に拡大し、下流の露光装置へ光を出射する。ミラー1の反射面1aと放射光の相対位置は、不図示の位置調整機構により、チャンバー6全体を駆動することにより精密に位置合わせされる。

50 ミラー1をチャンバー6に設置する前に、ミラー1の形

状を精密に測定しておくことで、ミラー1の反射面1aを裏面1bを基準にして精密に位置合わせすることが可能となる。位置決めに伴うチャンバー6の前後のビームラインに対する相対的な位置変動は、ベローズ8a,8bによって吸収が可能となっている。

【0022】また、ミラー1は、反射面1aによって、長波長側の光は反射するが、短波長の光はミラー1に吸収される。吸収された光は熱に変換され、ミラー1の内部を伝導し、大気中に露出しているミラー1の裏面1bより大気中に放出される。放出する熱量が空冷だけでは10十分に放出できない場合には、ミラー1の裏面に形成した冷却水通路もしくは、ミラー1内部に冷却水通路を設け、冷却水を循環させてもよい。

【0023】ミラー1の反射面1aが、損傷を受けたときなどは、ミラー1を交換する必要がある。ミラー1の交換は、ミラー1と枠2の結合部材ごと行なう。すなわち、交換手順は、ミラー固定部材4をチャンバー6から取り外し、ミラー1および枠2の結合体をチャンバー6から外す。そして、ガスケット3を新品のものに交換した後、新しいミラー1と枠2の結合体をミラー固定部材204によってチャンバー6に固定することで、交換は完了する。あらかじめ、交換用のミラー1と枠2の結合体材を作成して用意おくことで、交換に必要な時間は、短くて済む。

【0024】以上の構成によれば、ミラーチャンバー内は、入射光、反射光を通すだけのスペースがあれば良いので、ミラーチャンバーの体積が小さく、チャンバー内の表面積を小さくできる。このため、真空排気系の排気能力が比較的小さいもので済む。

【0025】なお、ミラー1と枠2のろう付け作業は、ミラー1の反射面1aの形状が熱変形することを避けるため、反射面1aの研磨の前に行ない、ろう付け後、円筒面に研磨加工される。ここでは、ミラー1と枠2の固着は、ろう付けとしたが、真空封止が可能な方法であれば、他の方法によって固着してもよい。また、ここでは、真空シール構造として、ガスケットを用いたが、Oリングを使用してもよい。

【0026】(第2の実施例)図3は本発明のミラーユニットの第1の実施例の縦断面図、図4は図1のA-A線断面図である。

【0027】本実施例は、第1の実施例と同じく、シンクロトロン放射光を利用した半導体露光装置において、 光源であるシンクロトロンリングと露光装置との間のシンクロトロン放射光の光路途中に設置されて、円筒状の反射面によりシート状のシンクロトロン放射光を垂直方向に拡大するためのミラーを支持するミラーチャンバーである。

【0028】図3及び図4中の構成部品には、図1及び図2と共通のものは同じ番号が使用されており、第1の実施例で説明したものは、ここでは、説明を省略する。

【0029】図3及び図4に示すように、ミラー1X は、反射面1Xaが半径100m程度の円筒状をしてお り、シート状のビームを垂直方向に拡大する。ミラー1 Xの側面周囲には、ミラー保持部材(ミラー取付けフラ ンジ) 12がろう付け等で固着されて、一体となってい る(ろう付け部分B参照)。ろう付けは、チャンバー6 内の真空を保つためにリークのないように行なわれる。 ミラー1 X とミラー保持部材12の結合部材は、チャン バー6の開口にミラー1Xの反射面1Xaが、チャンバ ー6の内部になるように設置される。チャンバー6の真 空気密性を保つために、ミラー保持部材12には、真空 シール用のエッジが環状に形成されており、対向位置に チャンパー6の開口に沿って作られたエッジとの間にガ スケット3を挟み込むことによって、真空をシールす る。ミラー1Xは、ミラー保持部材12をシール面の外 周に沿って複数本の固定ボルト5を均一に締め込むこと によってチャンバー6に固定される。

【0030】上記構成のミラーユニットは、シンクロトロンリングと露光装置との間のビームライン中に設置され、反射光をミラー1 Xで垂直方向に拡大し、下流の露光装置(不図示)へ光を出射する。ミラー1 Xの反射面1 X a と放射光の相対位置は、不図示の位置調整機構により、チャンバー6全体を駆動することにより精密に位置合わせされる。ミラー1 Xをチャンバー6 に設置する前に、ミラー1 Xの形状を精密に測定しておくことで、ミラー1 Xの反射面1 X a を裏面1 X b を基準として精密に位置合わせすることが可能となる。位置決めに伴うチャンバー6の前後のビームラインに対する相対的な位置変動は、ベローズ8 a、8 b によって吸収が可能となっている。

【0031】また、ミラー1Xは、その反射面1Xaによって、長波長側の光は反射するが、短波長の光はミラー1Xに吸収される。吸収された光は熱に変換され、ミラー1Xの再面1Xbより大気中に放出される。放出する熱量が空冷だけでは十分に放出できない場合には、ミラー1Xの裏面1Xbに形成した冷却水通路もしくは、ミラー1X内部に冷却水通路を設け、冷却水を循環させてもよい。

40 【0032】ミラー1 Xの反射面1 X a が損傷を受けたときなどは、ミラー1 Xを交換する必要がある。ミラー1 Xの交換は、ろう付けによって一体化している、ミラー1 Xとミラー保持部材12の結合部材ごとに行なう。すなわち、交換手順は、固定ボルト5を取り外し、ミラー1 Xとミラー保持部材12の結合部材をはずし、ガスケット3を交換し、新しいミラー1 Xとミラー保持部材12の結合部材をチャンバー6 に、固定ボルト5よって固定することで、交換が完了する。あらかじめ、交換用のミラー1 Xとミラー保持部材12の結合部材を作成し50 て用意おくことで、交換に必要な時間は、短くて済む。

【0033】以上の構成によれば、ミラーチャンバー内 は、入射光、反射光を通すだけのスペースがあれば良い ので、ミラーチャンバーの体積が小さく、チャンバー内 の表面積を小さくできる。とのため、真空排気系の排気 能力が比較的小さいもので済む。

【0034】なお、ミラー1Xとミラー保持部材12の ろう付け作業は、ミラー1Xの反射面1Xaの形状が熱 変形することを避けるため、反射面1 X a の研磨の前に 行ない、ろう付け後、円筒面に研磨加工される。とこで は、ミラー1Xとミラー保持部材12の固着は、ろう付 10 けとしたが、真空封止が可能な方法であれば、他の方法 によって固着してもよい。また、ここでは、真空シール 構造として、ガスケットを用いたが、○リングを使用し てもよい。

【0035】 (第3の実施例) 図5は本発明のミラーユ ニットの第3の実施例の縦断面図、図6は第3の実施例 の一部を破断した斜視図、図7の(a)は図5のA-A 線断面図、図7の(b)はミラーとミラー保持部材との 接合部の拡大断面図である。

【0036】本実施例は、第一の実施例と同じく、シン 20 クロトロン放射光Cを利用した半導体露光装置におい て、光源であるシンクロトロンリングと露光装置との間 のシンクロトロン放射光Cの光路途中に設置されて、円 筒状の反射面によりシート状のシンクロトロン放射光C を垂直方向に拡大するためのミラーを支持するミラーチ ャンバーである。シンクロトロン放射光Cの光路である チャンバー (ビームラインとも言う) の内部は、真空と なっている。

【0037】図5乃至図7において、図1及び図2と共 説明したものは、ここでは、説明を省略する。

【0038】図5乃至図7に示すように、ミラー1Y は、反射面1Yaが半径100m程度の円筒状をしてお り、シート状のビームを垂直方向に拡大する。ミラー 1 Yの側面周囲には、ミラー保持部材13がろう付けで固 着されて、一体となっている(ろう付け部分 B 参照)。 ろう付けは、チャンバー6内の真空を保つためにリーク のないように行なわれる。ミラー保持部材13は、ミラ -1 Yとろう付けされる部分がアーチ状のばね構造とな っている。このアーチ部14が、ミラー保持部材13を チャンパー6に固定する固定ボルト5の締め付け力が不 均等であったときに発生する変形を吸収し、ミラー1 Y の反射面 1 Y a がひずむのを防止する。 ミラー保持部材 13はチャンバー6の開口に、ミラー1Yの反射面1Y aがチャンバー6の内部になるように、設置される。チ ャンバー6の真空気密性を保つために、ミラー保持部材 13には、真空シール用のエッジ18 (図7の(b)参 照)が環状に形成されており、対向位置にチャンバー6 の開口に沿って作られたエッジ19(図7の(b)参

空をシールする。ミラー1 Yは、ミラー保持部材13を 固定ボルト5で締結してチャンバー6に固定される。 【0039】上記構成のミラーユニットは、シンクロト ロンリングと露光装置の間のビームライン中に設置さ れ、反射光をミラー1 Yで垂直方向に拡大し、下流の露 光装置(不図示)へ光を出射する。ミラー1 Yの反射面 1Yaと放射光の相対位置は、不図示の位置調整機構に より、チャンバー全体を駆動することにより精密に位置 合わせされる。ミラー1 Yをチャンバー6 に設置する前 に、ミラー1Yの形状を精密に測定しておくことで、ミ ラー1Yの反射面1Yaを裏面1Ybを基準として精密 に位置合わせすることが可能となる。位置決めに伴うチ ャンバー6の前後のビームラインに対する相対的な位置 変動は、ベローズ8a,8bによって吸収が可能となっ ている。また、チャンバー6内部が、真空の場合と、大 気開放された状態では、アーチ部14の変形によりミラ -1Yの位置が変化する。とのため、ミラー1Yの位置 出しは、チャンバー6を真空状態にして行なう必要があ る。

【0040】また、ミラー1Yは、反射面1Yaによっ て、長波長側の光は反射するが、短波長の光はミラー1 Yに吸収される。吸収された光は熱に変換され、ミラー 1 Yの内部を伝導し、大気中に露出しているミラー1 Y の裏面1Ybより大気中に放出される。放出する熱量が 空冷だけでは十分に放出できない場合には、ミラー1 Y の裏面1 Y b に形成した冷却水通路もしくは、ミラー1 Y内部に冷却水通路を設け、冷却水を循環させてもよ 44

【0041】ミラー1Yの反射面1Yaが、損傷を受け 通部分は、同じ番号が添えられている。第1の実施例で 30 たときなどは、ミラー1Yを交換する必要がある。ミラ -1 Yの交換は、ろう付けによって一体化しているミラ -1Yとミラー保持部材13の結合部材ごとに行なう。 手順は、固定ボルト5を取り外し、ミラー1Yとミラー 保持部材13の結合部材をチャンバー6から外し、ガス ケット3を交換し、新しいミラー1とミラー保持部材1 3の結合部材を固定ボルト5よってチャンバー6に固定 し、完了する。あらかじめ、交換用のミラー1Yとミラ ー保持部13の結合部材を作成して用意おくことで、交 換に必要な時間は、短くて済む。

【0042】以上の構成によれば、ミラーチャンバー内 は、ミラー入射、反射光を通すだけのスペースがあれば 良いので、ミラーチャンバーの体積が小さく、チャンバ 一内の表面積を小さくできる。このため、真空排気系の 排気能力が小さくて済む。なお、ミラー1 Y とミラー取 付部材13のろう付け作業は、ミラー1Yの反射面1Y aの形状が熱変形することを避けるため、反射面 1 Y a の研磨の前に行ない、ろう付け後、円筒面に研磨加工さ れる。ことでは、ミラー1 Yとミラー保持部材13の固 着は、ろう付けとしたが、真空封止が可能な方法であれ 照)との間にガスケット3を挟み込むことによって、真 50 ば、他の方法によって固着してもよい。また、ここで

ある。

は、真空シール構造として、ガスケットを用いたが、O リングを使用してもよい。

【0043】(第4の実施例)図8は本発明のミラーユニットの第4の実施例の縦断面図、図9は図8のA-A 線断面図、図10は第4の実施例の上面図である。

【0044】本実施例は、第1の実施例と同じく、シンクロトロン放射光Cを利用した半導体露光装置において、光源であるシンクロトロンリングと露光装置の間のシンクロトロン放射光Cの光路途中に設置されて、円筒状の反射面によりシート状のシンクロトロン放射光Cを 10 垂直方向に拡大するためのミラーを支持するミラーユニットである。シンクロトロン放射光Cの光路であるチャンバー(ビームラインとも言う)の内部は、真空となっている。

【0045】図8乃至図10に示した構成部品には、図1と共通のものは、同じ番号が添えられている。第1の実施例で説明したものは、ここでは、説明を省略したものもある。

【0046】図8乃至図10に示すように、ミラー12 は、その反射面12aが半径100m程度の円筒状をし 20 ており、シート状のビームを垂直方向に拡大する。ミラ ー1 Zは、反射面1 Z aの裏面1 Z b 全体が均一に、ミ ラー保持部材としてのミラー保持ブロック15に全面ろ う付けで固着され、一体となっている(ろう付け部分B 参照)。ミラー保持ブロック15は、チャンバー6の開 口に、ミラー1 Zの反射面1 Zaがチャンバー6の内部 になるように、設置される。チャンバー6の真空気密性 を保つために、ミラー保持ブロック15には、真空シー ル用のエッジが環状に形成されており、対向位置にチャ ンバー6の開口に沿って作られたエッジとの間にガスケ ット3を挟み込むことによって、真空をシールする。ミ ラー12は、ミラー保持ブロック15を固定ボルト5で 締結してチャンパー6に固定される。 ミラー保持ブロッ ク15を固定ボルト5で締結する際、不均質な力が発生 し、ミラー保持ブロック15が変形し、ミラー12の反 射面12aがひずむことのないようにミラー保持ブロッ ク15は十分な強度を有し、さらにミラー1との接合面 周囲に、溝が設けられている。また、ミラー保持ブロッ ク15の裏面は、精度のよい平面に仕上げられており、 ミラー1 Zの反射面1 Z a の位置合わせの基準とする。 【0047】シンクロトロン放射光は、ミラー12で反 射されるが、短波長の光はミラー12に吸収され、熱に 変換される。その熱によりミラー12が熱膨張により変 形する恐れがある。 とのためミラー12に吸収された熱 を冷却するために、ミラー保持ブロック15内には、冷 却水を流すための流路16(冷却水路)が設けられてい る。冷却水は、冷却水導入部17aより流路16へ導か れ、ミラー12から伝導した熱を奪い、冷却水排出部1 7 b より排出される。冷却水は、不図示の冷却装置によ り一定温度に保たれる。

【0048】上記の構成のミラーユニットは、シンクロ トロンリングと露光装置との間のビームライン中に設置 され、反射光をミラー12で垂直方向に拡大し、下流の 露光装置へ光を出射する。ミラー12の反射面12aと 放射光の相対位置は、不図示の位置調整機構により、チ ャンパー全体を駆動することにより精密に位置合わせさ れる。ミラー1 Zをチャンバー6 に設置する前に、ミラ ー1 Zが固着されたミラー保持ブロック15の形状を精 密に測定しておくことで、ミラー保持ブロック15の外 側(ミラーチャンバーの大気側)の面を基準としてミラ ー1 Zの反射面12aを精密に位置合わせすることが可 能となる。位置決めに伴うチャンバー6の前後のビーム ラインに対する相対的な位置変動は、ベローズ8 a. 8 bによって吸収が可能となっている。また、チャンバー 6内部が、真空の場合と、大気開放された状態では、大 気圧によってチャンバー6全体が変形する。そのため、 高精度の位置決めを必要とする場合は、ミラー1Zの位 置出しは、チャンバー6を真空状態にして行なう必要が

10

【0049】ミラー12の反射面12aが、損傷を受け たときなどは、ミラー12を交換する必要がある。ミラ ー1 Zの交換は、ろう付けによって一体化しているミラ ー1 Zとミラー保持ブロック15の結合部材ごとに行な う。手順は、固定ボルト5を取り外し、ミラー12と、 ミラー保持ブロック15の結合部材をチャンバー6から 外し、そして、冷却配管(図不示)を冷却水導入部17 a及び冷却水排出部17bからはずし、新たなミラー1 Zとミラー保持ブロック15の結合部材に配管を取付 け、ガスケット3を交換し、新しいミラー12とミラー 30 保持ブロック15の結合部材をチャンバー6に固定ボル ト5よって固定し、完了する。冷却水の配管取付け作業 をミラーチャンバー内で行なう必要がないため、作業中 に冷却水をチャンバー6内に漏らしてしまうという誤作 業が起こらない。あらかじめ、交換用のミラー1 Z とミ ラー保持ブロック15の結合部材を作成して用意おくと とで、交換に必要となる時間は、短くて済む。

【0050】以上の構成によれば、ミラーチャンバー内は、ミラー入射、反射光を通すだけのスペースがあれば良いので、ミラーチャンバーの体積が小さく、チャンバー内の表面積を小さくできる。このため、真空排気系の排気能力が比較的小さくて済む。

【0051】なお、ミラー1 Zとミラー保持ブロック15のろう付け作業は、ミラー1 Zの反射面1 Zaの形状が熱変形することを避けるため、反射面1 Zaの研磨の前に行ない、ろう付け後、円筒面に研磨加工される。ここでは、ミラー1 Zとミラー保持ブロック15の固着は、ろう付けとしたが、真空封止が可能な方法であれば、他の方法によって固着してもよい。また、ここでは、真空シール構造として、ガスケットを用いたが、050 リングを使用してもよい。

【0052】以上本発明をシンクロトロン放射光を円筒 面の反射面を有するミラーによって、露光雰囲気を確保 する方法の露光装置に適用した4つの実施例について説 明したが、ミラー揺動方式にも適用可能であることは言 うまでもない。

【0053】次に、上記ミラーユニットを備えた露光装 置を利用したデバイスの製造方法について説明する。

【0054】図11は微小デバイス(ICやLSI等の 半導体チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、 マイクロマシン等)の製造のフローを示す。ステップS 10 1 (回路設計)では半導体デバイスの回路設計を行う。 ステップS2(マスク製作)では設計した回路パターン を形成したマスクを製作する。一方、ステップS3(ウ エハ製造)ではシリコン等の材料を用いてウエハを製造 する。ステップS4 (ウエハプロセス) は前工程と呼ば れ、上記用意したマスクとウエハを用いて、リソグラフ ィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次の ステップS5 (組立) は後工程と呼ばれ、ステップS4 によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化する 工程であり、アッセンブリ工程(ダイシング、ボンディ 20 ング)、パッケージング工程(チップ封入)等の工程を 含む。ステップS6(検査)ではステップS5で作製さ れた半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等 の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完 成し、これが出荷(ステップS7)される。

【0055】図12は上記ウエハプロセスの詳細なフロ ーを示す。ステップS11(酸化)ではウエハの表面を 酸化させる。ステップS12(CVD)ではウエハ表面 に絶縁膜を形成する。ステップS13 (電極形成)では ウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップS1 30 4 (イオン打ち込み)ではウエハにイオンを打ち込む。 ステップS15 (レジスト処理)ではウエハに感光剤を 塗布する。ステップS16 (露光) では上記説明した露 光装置によってマスクも回路パターンをウエハに焼付け 露光する。ステップS17 (現像)では露光したウエハ を現像する。ステップS18(エッチング)では現像し たレジスト像以外の部分を削り取る。ステップS19 (レジスト剥離)ではエッチングが済んで不要になった レジストを取り除く。これらのステップを繰り返し行う ことによって、ウエハ上に多重の回路パターンが形成さ 40 4 れる。本実施例の製造方法を用いれば、従来は製造が難 しかった高集積度の半導体デバイスを製造することがで きる。

[0056]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ミラーの反射面で吸収された熱が、真空中の界面を経ず に大気側に伝わり、冷却されるので、冷却効率がよい。 また、ミラーをチャンバーに取り付ける際、フランジを 取り付けるのと同様な方法でできるので、チャンバーの メンテナンスホールから手をチャンバー内部に入れて作 50 12, 13

業を行っていた従来の方法に比べ、格段に作業性が向上 し、ミラーの交換が容易となる。さらに、チャンパー内 部には可動部がないことと、チャンバー内には、ミラー の反射面が露出しているのみで、表面積が小さいことに より、真空排気系の排気能力が低くてもよい。以上の構 成により、コストが低く、メンテナンス性に優れ、信頼 性の高いミラーユニットを提供できる。

【0057】上記ミラーユニットを露光装置に適用する ことで、低コストで半導体デバイスを生産できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のミラーユニットの第1の実施例の縦断 面図である。

【図2】図1のA-A線断面図である。

【図3】本発明のミラーユニットの第2の実施例の縦断 面図である。

【図4】図3のA-A線断面図である。

【図5】本発明のミラーユニットの第3の実施例の縦断 面図である。

【図6】第3の実施例の一部を破断した斜視図である。

【図7】(a)は図5のA-A線断面図、(b)はミラ ーとミラー保持部材との接合部の拡大断面図である。

【図8】本発明のミラーユニットの第4の実施例の縦断 面図である。

【図9】図8のA-A線断面図である。

【図10】第4の実施例の上面図である。

【図11】本発明の露光装置を使用したデバイスの製造 のフロー図である。

【図12】図11のウエハプロセスの詳細なフロー図で ある。

【図13】従来の露光装置の一部を破断した斜視図であ

【図14】図13に示したミラー(反射鏡)ユニットの 拡大断面図である。

【符号の説明】

1, 1X, 1Y, 1Z ミラー (反射鏡)

la, 1Xa, 1Ya, 1Za 反射面

1b, 1Xb, 1Yb, 1Zb 裏面

枠 2

ガスケット

ミラー固定部材(ミラー保持部材)

5 固定部材

チャンバー

開口 6 a

前フランジ 7 a

7 h 後フランジ

8a, 8b ベローズ

9a, 9b リングガスケット

フランジ固定ボルト 10

1 1 フランジ固定ナット

ミラー保持部材

13

ミラー保持ブロック (ミラー保持部材)

14

15

16

17a 17b

100

101 102

1 0 3 1 0 5

106 107

108

18, 19

アーチ部

流路(冷却水通路)

冷却水導入部

冷却水排出部

ミラー

ベローズ 支持棒

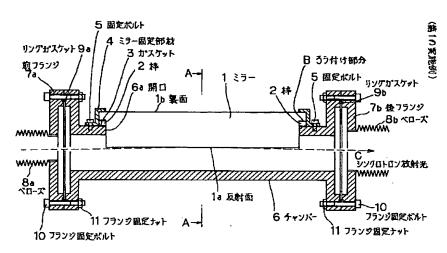
エッジ 真空チャンバー

ミラー保持器 支持板

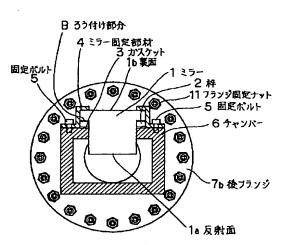
ミラー支持体 ミラー冷却用配管

			14
*	109	排気口	
	110	内部ベロ-	-ズ
	111	内部フラン	ンジ
	112	冷却流路	
	113	Oリング	
	114	貫通孔	
	115	基準フレー	-ム
	116	チルト板	
	117	駆動モー	ター
10	118	ガイド	
	119a	, 19b	調整ねじ
	B ろ	う付け部分	
	C シ	ンクロトロ	ン放射光
*	S1~S	19 ス	テップ

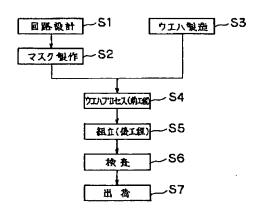
【図1】



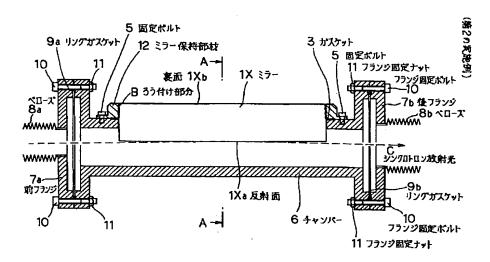
【図2】



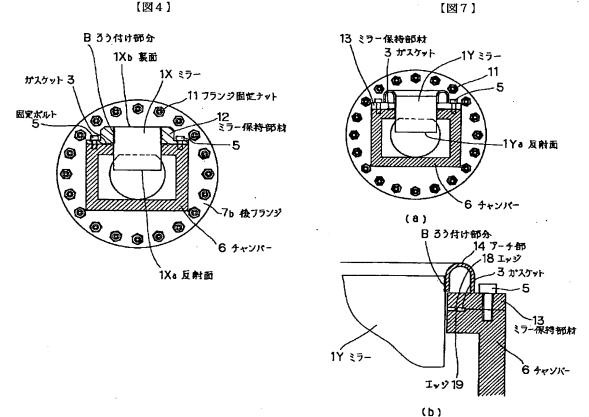
【図11】



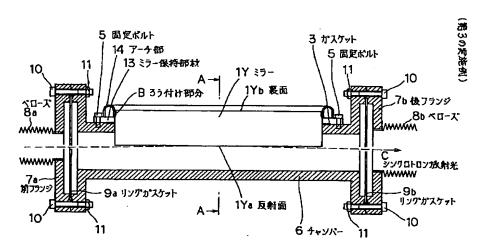
[図3]



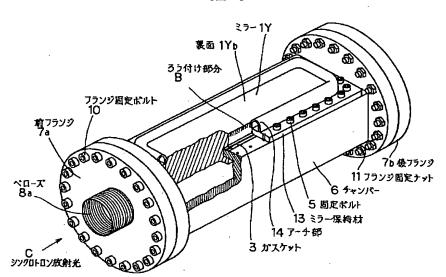
【図4】



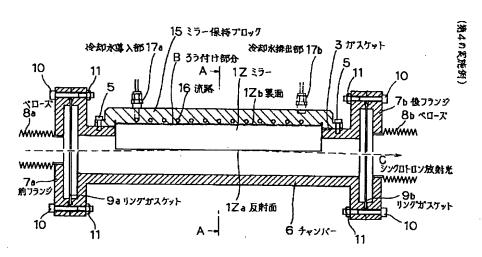
【図5】



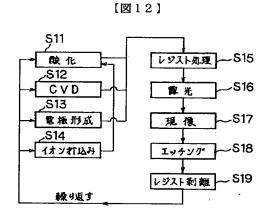
【図6】



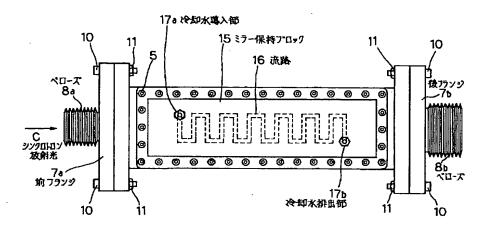
【図8】



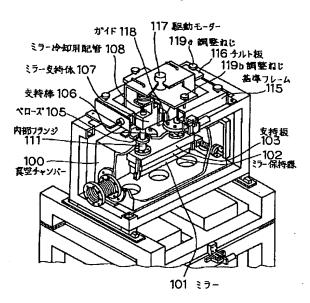
| 17a 冷却水導入部 | 16 流路 | 17b 冷却水排出部 | 17c | 17c



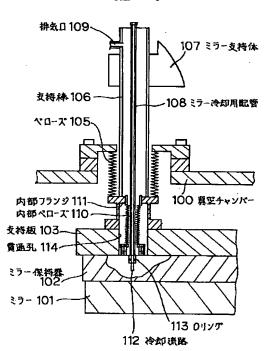
【図10】



【図13】



【図14】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号 X

FΙ

技術表示箇所

G21K 5/02 H01L 21/027